



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ديالى
كلية العلوم
قسم الفيزياء



تحضير أغشية $\text{Cu}_2\text{CoSnS}_4$ (CCTS) الرقيقة ودراسة خصائصها التركيبية والبصرية والكهربائية

رسالة مقدمة الى
مجلس كلية العلوم – جامعة ديالى وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في
علوم الفيزياء

من قبل

ميس اديب احمد

بكالوريوس علوم فيزياء 2015 م

بإشراف

أ.د. نبيل علي بكر أ. أسعد أحمد كامل

2019 م

ـ 1440

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صدق الله العظيم

سورة الطلاق آية (12)

الإهادء

إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو الامل والاماني الجميلة واتسع قلبه ليحتوي حلمي حين
ضاقت الدنيا ففرض الصعاب من اجلني وسار في حلقة الدرب ليغرس معاني النور والصفاء

في قلبي..... أبي الغالي

نبض الحياة ونعمه ربىأمي

ذخري وعوني وسندىإخوتي

(انيس، ياسر، سيف، حسام، اسيل، سارة، مروة، غفران، مودة)

كل صديق أراد لي النجاح..... و دعا لي

سارية العلم والعلمأساتذتي

الباحثة

شُكْر وَنِفَاضَاتٍ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، والصلوة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه اجمعين ومن سار على دربها واهتدى بهداه إلى يوم الدين... أما بعد، في بداية هذا العمل المتواضع الذي أسأل الله له القبول، لا يسعني إلا ان أتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى استاذي الفاضل أ.د. نبيل علي بكر واستاذي الفاضل أ. أسعد احمد كامل لتقضيلهما بالإشراف على هذه الدراسة، وللذين لم يألوا جهدا في التوجيه والمساعدة بكل ما هو مفيد، وكل ما ابدوه من ملاحظات وارشادات قيمة كان لها اكبر الأثر في انجاز هذا البحث واخراجه على اكمل وجه، جزاهما الله عنى خير الجزاء، كما اتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى عمادة كلية العلوم - قسم الفيزياء لمنحهم الفرصة لي لإكمال دراستي، كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى أ.د. صباح انور سلمان و أ.م. د. زياد طارق خضير و م. د. عمار عايش حبيب ولجميع اساتذتي الكرام في قسم الفيزياء لمدهم يد العون لي ومساعدتي طيلة فترة البحث داعية الله المولى عز وجل لهم بدوام الصحة والعافية وأن يحفظهم خدمة للعلم. واتقدم بجزيل شكري وامتناني الى جميع منتسبي مكتبة كلية العلوم وان انسى فلا انسى زملائي في مختبر الدراسات ومقاعد الدراسة. مع خالص شكري واعتزازي وتسامحي الى كل من وضع العثرات في طريقي ليجعلني اصلب عوداً وأكثر قوة وإيمانا في هذه الحياة. ولا يسعني إلا أن أسجل كلمات الشكر و الامتنان إلى الذين لم يخلوا علي بالعون و المساندة و النصيحة. و كل من فاتني ذكرهم و ساهموا بجهد أو كلمة طيبة لدعم هذا العمل. وفي الختام اللهم اني أسألك السداد والصلاح، وأن يكون عملي هذا خالصا لوجهك الكريم.

الخلاصة

تم في هذا البحث ترسيب أغشية المركب الرباعي $\text{Cu}_2\text{CoSnS}_4$ الرقيقة على قواعد زجاجية (SLG) بدرجة حرارة 400°C ، بطريقة التحلل الكيميائي الحراري (CSP) وسمك تقريبي ($350 \pm 10\text{ nm}$) وبتأثير تغير نسب تركيز الثايوريا في المحلول، وكانت نسبة الايونات السالبة (Anions) الى الايونات الموجبة (Cations) تساوي (1:5).

وقد تمت دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية من خلال استخدام تقنيات فحص حديثة وذات مواصفات عالية كحيدود الاشعة السينية (GIXRD) و المجهر الالكتروني الماسح الباعث للمجال (FE-SEM)، تأثير هول، مطياف رaman وكذلك مطياف الاشعة فوق البنفسجية- المرئية- تحت الحمراء القريبة بالمدى (300-1100 nm).

حيث اظهرت انماط حيدود الاشعة السينية (XRD) بأن جميع الاغشية المرسيبة التي تم ترسيبها تعود للمركب الرباعي CCTS النقي بتراكيب متعدد التبلور وطور (Stannite) الرباعي القائم وبالاتجاه السادس(204) فكلما كان تجانس المواد في المحلول افضل زاد تبلور الاغشية. وباعتماد طريقة (Scherrer Formula) تم حساب معدل الحجم البلوري للأغشية اذ بلغت اقصى قيمة له (10.61 nm) للغشاء CCTS4. ثم اكد تحليل طيف رامان نقافة طور تشكل اغشية المركب بظهور القمة الاساس للمركب CCTS في المدى ($321-325\text{cm}^{-1}$) ترافقها القمم الثانوية المعززة لها. و دلت نتائج (FE-SEM) على تكون تراكيب نانوية وبأشكال متعددة السطوح (Polyhedral shapes) شبيهة بالقرنيط (Cauliflower) مع وجود نمو ثانوي، اذ كانت اكبر قيمة لمعدل الحجم الحبيبي (24.86 nm) للغشاء CCTS1.

وقد تمت دراسة الخصائص البصرية للأغشية كافة من خلال تسجيل طيفي النفاذية والامتصاصية ولمدى الاطوال الموجية (300-1100 nm)، اذ اظهرت النتائج ان الامتصاص يحدث في المنطقة المرئية وفوق البنفسجية. من خلال معادلة (Tauc) تم حساب فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح فكانت قيمها تتراوح بين (1.3-1.85 eV) لذا تعتبر هذه الاغشية مناسبة للاستخدام في تطبيقات الخلايا الشمسية، وحسبت الثوابت البصرية (معامل الامتصاص، ثابت العزل البصري بجزئيه الحقيقي والخيالي) كدالة لطاقة الفوتون

ومعامل الانكسار ومعامل الخمود كدالة للطول الموجي اذ كانت قيم معامل الامتصاص بحدود (10^2 cm^{-1}) .

بين قياس تأثير هول ان اعلى قيمة للتوصيلية كانت $(\Omega \cdot \text{cm})^{-1} = 0.4174$ للعشاء CCTS4 تقابلها اعلى تحركية بقيمة $(1.822 \text{ cm}^2/\text{V.s})$.

قائمة المحتويات

| رقم الصفحة | العنوان | الفقرة |
|------------|---|--------------|
| I | قائمة المحتويات | |
| VI | قائمة الاشكال | |
| X | قائمة الجداول | |
| XI | قائمة الرموز | |
| XIV | قائمة الاختصارات | |
| 1-20 | مقدمة عامة (General Introduction) | الفصل الاول |
| 1 | المقدمة (Introduction) | (1-1) |
| 2 | طرائق تحضير الااغشية الرقيقة (Thin Films Preparation Methods) | (2-1) |
| 4 | طريقة التحلل الكيميائي الحراري (Chemical spray Pyrolysis method(CSP)) | (3-1) |
| 5 | آلية تكوين الااغشية الرقيقة (Mechanism of Thin Films Formation) | (4-1) |
| 7 | تأثير حجم قطرة (The Drop Size Effect) | (5-1) |
| 9 | تركيب اغشية $(\text{Cu}_2\text{CoSnS}_4)$ الرقيقة (Crystal Structure of (CCTS) Thin Films) | (6-1) |
| 10 | تطبيقات اغشية (CCTS) الرقيقة (Applications of (CCTS) Thin films) | (7-1) |
| 10 | الدراسات السابقة (Literature Review) | (8-1) |
| 20 | الهدف من البحث (Aim of The work) | (9-1) |
| 21-56 | الجزء النظري (Theoretical Part) | الفصل الثاني |
| 21 | المقدمة (Introduction) | (1-2) |
| 21 | اشباه الموصلات (Semiconductors) | (2-2) |

| | | |
|-------|--|--------------|
| 22 | التركيب البلوري لأشباه الموصلات (Crystal structure of Semiconductors) | (3-2) |
| 22 | أشباه الموصلات البلورية (Single Crystal Semiconductors) | (1-3-2) |
| 24 | أشباه الموصلات العشوائية (Amorphous Semiconductors) | (2-3-2) |
| 25 | مركبات $(\text{Cu}_2\text{-II-IV-VI}_4)$ ($\text{Cu}_2\text{-II-IV-VI}_4$ Compounds) | (4-2) |
| 28 | نظرية حزم الطاقة في المواد الصلبة (Energy Band Theory in Solid Materials) | (5-2) |
| 31 | الخصائص التركيبية (Structural Properties) | (6-2) |
| 31 | حيود الاشعة السينية (X-Ray diffraction) | (1-6-2) |
| 33 | قانون براك للحيود (The Bragg law of diffraction) | (2-6-2) |
| 34 | المعلمات التركيبية (Structural Parameters) | (7-2) |
| 37 | مطياف رaman (Raman Spectroscopy) | (8-2) |
| 41 | تفاعل الضوء مع شبه الموصل (Interaction Of Light with Semiconductor) | (9-2) |
| 42 | الخصائص البصرية (Optical Properties) | (10-2) |
| 54 | الخصائص الكهربائية (Electrical Properties) | (11-2) |
| 57-74 | الجزء العملي | الفصل الثالث |
| 57 | المقدمة (Introduction) | (1-3) |
| 58 | منظومة التحلل الكيميائي الحراري (Chemical Spray Pyrolysis System) | (2-3) |
| 63 | تحضير الأغشية الرقيقة (Preparation of Thin Films) | (3-3) |
| 63 | تنظيف قواعد الترسيب (Cleaning Substrate Deposition) | (1-3-3) |
| 64 | تحضير محلول (Preparation of Solution) | (2-3-3) |
| 66 | ترسيب الأغشية (Deposition of Films) | (3-3-3) |

| | | |
|--------|--|--------------|
| 68 | قياس سمك الأغشية (Measurement of Films Thickness) | (4-3) |
| 69 | التقنيات المستخدمة في دراسة الخصائص التركيبية للأغشية (CCTS) (Technique Used to Study the Structure Properties of(CCTS)Thin Films) | (5-3) |
| 69 | تقنية حيود الأشعة السينية (X-Ray diffraction Technique) | (1-5-3) |
| 71 | المجهر الإلكتروني الماسح الباعث للمجال (Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) Measurements) | (2-5-3) |
| 73 | مطيافية رaman (Raman Spectroscopy Measurements) | (3-5-3) |
| 73 | القياسات البصرية (Optical Measurements) | (6-3) |
| 74 | القياسات الكهربائية (Electrical Measurements) | (7-3) |
| 75-105 | النتائج والمناقشات (Results and Discussion) | الفصل الرابع |
| 75 | المقدمة (Introduction) | (1-4) |
| 75 | نتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) | (2-4) |
| 75 | نتائج فحوصات حيود الأشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) | (1-2-4) |
| 79 | ثوابت الشبكة (c/a) ونسبة متوجه الشبكة (a, c) ونسبة متوجه الشبكة (c/a) (Lattice Constant (a, c) and lattice Vector (c/a)) | (1-1-2-4) |
| 79 | عامل التشكيل (Texture Coefficient (T _c)) | (1-2-2-4) |
| 79 | معدل الحجم البلوري (Average Crystalline size (D _{ave})) | (1-3-2-4) |
| 82 | نتائج تحليل طيف رaman (Results of Raman Spectroscopy Measurements) | (2-2-4) |
| 85 | نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح الباعث للمجال (Results of Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM)Tests) | (3-2-4) |
| 89 | نتائج القياسات البصرية (Results of Optical Measurements) | (3-4) |

| | | |
|-----|--|---------|
| 90 | الامتصاصية (Transmission and Absorption) | (1-3-4) |
| 91 | معامل الامتصاص (Absorption Coefficient (α)) | (2-3-4) |
| 92 | حسابات فجوة الطاقة (Calculation of energy gap(E_g)) | (3-3-4) |
| 94 | معامل الانكسار (Refractive index (n_o)) | (4-3-4) |
| 95 | معامل الخمود (Extinction Coefficient (k_o)) | (5-3-4) |
| 96 | ثابت العزل البصري (Optical Dielectric Constant) | (6-3-4) |
| 97 | نتائج الفحوصات الكهربائية (Electrical Measurements) | (4-4) |
| 100 | الاستنتاجات (Conclusions) | (5-4) |
| 101 | المشاريع المستقبلية (Future works) | (6-4) |
| | المصادر (References) | |

قائمة الاشكال

| الصفحة | عنوان الشكل | الرقم |
|--------|---|--------------|
| 1-20 | مقدمة عامة | الفصل الاول |
| 3 | مخطط للطائق الشائعة في ترسيب الاغشية الرقيقة | (1-1) |
| 6 | مراحل تكوين الاغشية الرقيقة | (2-1) |
| 8 | تأثير طبيعة الاغشية الرقيقة المترسبة بحجم القطرة و درجة حرارة القاعدة | (3-1) |
| 9 | البناء البلوري لمركب (CCTS) | (4-1) |
| 21-56 | الجزء النظري | الفصل الثاني |
| 24 | ترتيب الذرات في المواد الصلبة | (1-2) |
| 26 | بعض انواع مركبات كبريتيد النحاس | (2-2) |
| 27 | اشتقاق المركبات الثلاثية والرباعية من مشبك الزنك | (3-2) |
| 28 | كثافة الحالات في مركبات كبريتيد النحاس الرباعية | (4-2) |
| 29 | حزم الطاقة في المواد الصلبة | (5-2) |
| 30 | انشطار حزم الطاقة | (6-2) |
| 32 | حيود الاشعة السينية (XRD) في الاغشية الرقيقة : عشوائية b: احادية التبلور c: متعددة التبلور | (7-2) |
| 34 | الحيود في المستويات البلورية | (8-2) |
| 40 | استطارة رaman واستطارة رايلي | (9-2) |
| 40 | مخطط لأجزاء تقنية تحليل طيف رaman | (10-2) |
| 45 | حافة الامتصاص البلورية في شبه الموصل البلوري | (11-2) |

| | | |
|--------|---|--------------|
| 48 | الانتقالات الالكترونية المباشرة وغير المباشرة | (12-2) |
| 56 | التكوين الاساسي لظاهرة هول | (12-2) |
| 57-74 | الجزء العملي | الفصل الثالث |
| 57 | خطوات تحضير ودراسة الاغشية المحضررة | (1-3) |
| 58 | منظومة الرش الكيميائي الحراري المستعملة في تحضير الاغشية | (2-3) |
| 60 | رسم تخطيطي لجهاز الرش | (3-3) |
| 62 | مقياس تدفق الهواء | (4-3) |
| 70 | التخسيص بالأشعة السينية | (5-3) |
| 72 | الرسم التخطيطي لجهاز FE-SEM | (6-3) |
| 74 | (a) صورة لجهاز قياس تأثير هول (b) قاعدة النماذج | (7-3) |
| 75-101 | النتائج والمناقشة | الفصل الرابع |
| 76 | انماط حيوان الأشعة السينية للأغشية CCTS الرقيقة بتأثير تغير تركيز الثايلوريا في محلول | (1-4) |
| 77 | بطاقة (ICDD) لمركب (CCTS) المرقمة (26-0513) | (2-4) |
| 81 | معدل حجم الببوريات للأغشية (CCTS(1,2,3,4,5,6,7) | (3-4) |
| 84 | قمم طيف رaman الناتجة للغشاءين CCTS(1,2,3,4,5,6,7) | (4-4) |
| 86 | صور CCTS(1,2,3) FE-SEM للأغشية | (5a-4) |
| 87 | صور CCTS(4,5,6) FE-SEM للأغشية | (5b-4) |
| 88 | صور FE-SEM للعينات (7) CCTS مع صورة المقطع العرضي للعينتين (CCTS4,7) | (5c-4) |
| 89 | تغير معدل الحجم الحبيبي مع نسب تركيز الثايلوريا في محلول | (6-4) |
| 90 | امتصاصية أغشية المركب CCTS | (7-4) |
| 91 | معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون للأغشية CCTS | (8-4) |
| 93 | دالة لطاقة الفوتون للأغشية $(\alpha hv)^2$ CCTS(1,2,3,4,5,6,7) | (9-4) |

| | | |
|----|---|---------|
| 94 | معامل الانكسار لاغشية CCTS | (10-4) |
| 95 | معامل الخمود لاغشية CCTS | (11-4) |
| 96 | الجزء الحقيقي لثابت العزل لاغشية CCTS | (12a-4) |
| 97 | الجزء الخيالي لثابت العزل لاغشية CCTS | (12b-4) |
| 99 | العلاقة بين نسب تركيز الثايروريا كل من التوصيلية والمقاومة في اغشية CCTS | (14a-4) |
| 99 | علاقة كل من تركيز حاملات الشحنة وتحركيتها مع نسب تركيز الثايروريا | (14b-4) |

قائمة الجداول

| الصفحة | عنوان الجدول | الرقم |
|--------|---|-------|
| 64 | بعض من خصائص المواد الأولية المستخدمة في تحضير الأغشية | (1-3) |
| 79 | موقع القمم والمسافة البينية للمستويات البلورية وعرض منتصف القمة والحجم البلوري ومعدل الحجم البلوريات لكافة اغشية CCTS المحضرة | (1-4) |
| 81 | قيم كثافة الانخلاءات وعدد البلوريات وعامل التشكيل والمطابقة الميكروية لنماذج اغشية CCTS الرقيقة | (2-4) |
| 81 | قيم ثوابت الشبكة ونسبة متجه الشبكة وحجم خلية الوحدة المحسوبة لأغشية CCTS الرقيقة | (3-4) |
| 84 | نتائج تحليل طيف رaman | (4-4) |
| 86 | معدل الحجم الحبيبي المحسوب من خلال صور - FE SEM | (5-4) |
| 93 | قيم فجوة الطاقة | (6-4) |
| 99 | نتائج قياس تأثير هول | (7-4) |

قائمة الرموز

| وحدة القياس | المعنى | الرمز |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| cm^{-1} | معامل الامتصاص | α |
| m/s | سرعة الضوء في الفراغ | c |
| cm/v.s | تحركية هول | μ_H |
| cm^3/C | معامل هول | R_H |
| cm^{-3} | تركيز حاملات الشحنة | n_H |
| eV | طاقة الفونون | E_{ph} |
| eV | فجوة الطاقة البصرية | E_g^{opt} |
| J/K | ثابت بولتزمان | k_B |
| J.s | ثابت بلانك | h |
| Mol/L | التركيز المولاري | M |
| g/mol | الوزن الجزيئي | M_{wt} |
| eV | فجوة الطاقة | E_g |
| \AA | المسافة بين المستويات البلورية | d_{hkl} |
| nm | الطول الموجي | λ |
| deg | زاوية سقوط الأشعة السينية | θ |
| $(\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$ | التوصيلية الكهربائية | σ |
| C | شحنة الإلكترون | e |
| s^{-1} | التردد الزاوي | w |
| C/V.m^2 | سماحية الفراغ | ϵ_0 |
| $\text{eV/m}^2 \cdot \text{s}$ | الشدة النافذة | I_x |
| $\text{eV/m}^2 \cdot \text{s}$ | الشدة الساقطة | I_o |
| \AA | ثوابت الشبكة | a, c |

| V | فولتية هول | V _H |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| W/m ² | شدة المجال المغناطيسي | B _z |
| A.cm ⁻² | كثافة التيار | J |
| g | كتلة مادة الغشاء | m |
| nm | سمك الغشاء | t |
| cm ² | مساحة الغشاء | S |
| g/cm ³ | كثافة مادة الغشاء | ρ |
| eV | طاقة الفونون | E _{ph} |
| cm ² /v.s | تحريكية الإلكترونات | μ _n |
| cm ² /v.s | تحريكية الفجوات | μ _p |
| - | عدد الإلكترونات لوحدة الحجم | n |
| - | عدد الفجوات لوحدة الحجم | p |
| - | النفادية | T |
| - | الانعكاسية | R |
| - | الامتصاصية | A |
| - | معامل الانكسار المعقد | N |
| - | الجزء الحقيقي من معامل الانكسار | n ₀ |
| - | معامل الخمود | K _o |
| - | ثابت العزل الكهربائي | ε |
| - | الجزء الحقيقي لثابت العزل | ε ₁ |
| - | الجزءخيالي لثابت العزل | ε ₂ |

قائمة المختصرات

| المعنى | الاختصار |
|--|---------------|
| Copper Cobalt Tin Sulfied | CCTS |
| Full Width at Half Maximum | FWHM |
| Chemical Spray Pyrolysis | CSP |
| X-ray diffraction | XRD |
| Grazing Incidence X-Ray Diffraction | GIXRD |
| International Center for Diffraction Data | ICDD |
| Ultra Violet | UV |
| Soda Lime Glass | SLG |
| Field Emission Scanning Electron Microscopy | FE-SEM |

الفصل الأول

مقدمة عامة

Chapter One
General
Introduction

(Introduction)

(1-1) المقدمة

إن مصطلح الاغشية الرقيقة يطلق لوصف طبقة او عدة طبقات (Layers) من ذرات المادة لا يتعدى سمكها المايكرومتر الواحد او عدة اجزاء من النانومتر إذ أن الاغشية المحضرة رقيقة وهشة جدا (سهلة الكسر) لذا ترسب على قواعد صلبة و بطرائق مختلفة[1]. من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة المتتجدد الدائمة والنظيفة من خلايا شمسية توجهت جهود الباحثين نحو تحضير مواد جديدة تمكن من انتاج الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء[2]. محاولة منهم للاستعاضة عن السليكون المتبلور بسبب محدوديته وغلائه بمواد شبه موصلة اكثر انتشارا واقل كلفة من خال تحضير طبقات ماصة (طبقة فعالة) باستخدام تقانة الاغشية الرقيقة[3]. ومع ذلك يتم انتاج اكثر من 80% من الطاقة في العالم عن طريق الوقود الاحفورى غير المتتجدد (الفحم، النفط، والغاز الطبيعي) حيث ادى الاستخدام المفرط لهذا النوع من الوقود الى تلوث البيئة[4]. وأن كل عمليات اتلاف الخلايا الشمسية ذات الاغشية الرقيقة هي مصدر قلق كبير. لذلك بذلت جهود كبيرة منذ بداية عام 1950 للقيام بتصميم أشباه موصلات كالكوجيناید الرباعية، هذه المركبات أصبحت موضوع الاهتمام البحثي المكثف للباحثين ذلك لأنها تتكون من عناصر متوفرة وغير سامة و تمتلك فجوة طاقة مثالية لكثير من التطبيقات الضوئية[5]. إذ ان التقدم الاخير للمواد الماصة او الطبقات الفعالة اقتصر على المركبات الثنائية والثلاثية والرباعية مثل ($\text{SnS}, \text{FeS}, \text{Cu}_3\text{BiS}_3, \text{Cu}_2\text{SnS}_3, \text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$) [2]، وقد كرس اغلب الباحثين عملهم في دراسة وتحضير اغشية $\text{Cu}_2\text{CoSnS}_4$ احد مركبات عائلة شبه الموصل $\text{Cu}-\text{II}_2-\text{III}-\text{VI}_4$ بتركيب نانوية [6].

و لا يزال تحضير اغشية CCTS تحديا لأن CCTS مركب رباعي مخطط الطور له معقد جدا وعادة ما يكون من الصعب السيطرة على عملية التتوي والنمو أثناء التحضير مع ذلك فقد حضرت اغشية CCTS في الآونة الأخيرة بنجاح بطريقتين مختلفتين بهدف استخدامها في التطبيقات الفولتاوصية منها (electrospinning) و (sol-gel) و (hot injection) و (solvothermal)، طريقة التحلل الكيميائي الحراري بالرش، ونظرا لما تقدم عن أهمية اغشية CCTS في الكثير من التطبيقات وفي العديد من المجالات فقد ارتأينا الى دراسة تأثير تركيز عنصر الكبريت في اغشية المركب CCTS بطريقة التحلل الكيميائي الحراري.

(2-1) طرائق تحضير الاغشية الرقيقة

(Thin Films Preparation Methods)

خلال العقود العديدة الماضية، حظيت طرائق الترسيب باهتمام كبير، وعلى مر السنين اكتشفت وطور العلماء طرائق عديدة لتحضير الاغشية الرقيقة وبذلك تعددت طرائق تحضيرها وأصبح لكل طريقة مميزاتها لتوسيع الغرض الذي ابتكرت من أجله، وان اختيار الطريقة المناسبة لتحضير الغشاء يعتمد على خواص عدة منها طبيعة التطبيق ونوعه وكلفة التحضير وسهولته وسرعةه بالإضافة إلى نوع المواد المستخدمة في التحضير. ويمكن تقسيم طرائق تحضير الاغشية الرقيقة إلى نوعين رئيين [7]. الموضحة في الشكل (1-1) [8].

■ **الطرائق الفيزيائية (Physical Methods)**

■ **الطرائق الكيميائية (Chemical Methods)**

ترسيب الأغشية الرقيقة

Thin Films Deposition

طرق الترسيب الفيزيائي

Physical Deposition Techniques

الترذيز

Sputtering

الترذيز بالتيار المستمر

D.C Sputtering

الترذيز التفاعلي

Reactive Sputtering

الترذيز بالحزمة الایونية

Ion beam Sputtering

الترذيز تحت ضغط واطئ

Low-Pressure Sputtering

الترذيز بالتردد الراديو المغناطيسي

r.f Magnetron Sputtering

التبخير

Evaporation

التبخير بالليزر

Laser Evaporation

التبخير بالوميض

Flash Evaporation

التبخير بالقوس

Arc Evaporation

الترسيب الفيزيائي للبخار

Physical Vapor Deposition

طرق الترسيب الكيميائي

Chemical Deposition Techniques

الترسيب بالبخار

Vapor Deposition

التحلل الكيميائي الحراري

Chemical Spray Pyrolysis

التبخير بالضغط الواطئ

Low Pressure

التبخير بالبلازما

Plasma Evaporation

البلمرة

Polymerization

المحلول الغروي

Sol-Gel

الترسيب بالتحليل

Electrolytic Deposition

الطلاء الكهربائي

Electro Plating

الطلاء اللاكهربائي

Electro less Plating

ال الطلاء بالبرم

Spin Coating

الشكل (1-1): مخطط للطرق الشائعة في ترسيب الأغشية الرقيقة [8].

(3-1) التحلل الكيميائي الحراري

(Chemical Spray Pyrolysis method(CSP))

تم في هذا البحث اعتماد تقنية التحلل الكيميائي الحراري، اذ تحضر الاغشية بهذه الطريقة عن طريق رش محلول المادة المراد ترسيب الغشاء الرقيق منها على قواعد ساخنة بدرجة حرارة ملائمة بحيث تكون اقل من درجة حرارة تطوير المادة. اذ يتكون الغشاء بعد التفاعل الذي يحدث بين ذرات المادة والقاعدة الساخنة ومن الممكن تحديد سمك الغشاء من خلال التحكم بمعدل الترسيب [9].

محاسن طريقة التحلل الكيميائي الحراري:

- تعد طريقة اقتصادية نظرا لبساطة وقلة تكلفة الاجهزة المستخدمة لترسيب الاغشية.
- يمكن تحضير الاغشية فيها بمواصفات جيدة (تجانس عالي وبمساحات كبيرة).
- تعد طريقة ملائمة لترسيب اغشية لمركبات يتعدد تحضيرها بطريقتين اخري مثل اكاسيد وكبريتات المواد.
- تمتاز الاغشية الرقيقة المحضرة بهذه الطريقة بالتصاقها القوي بالقاعدة.
- يمكن تحضير الأغشية من مزج مادتين أو أكثر وكذلك يمكن تغيير النسب الدالة في الغشاء.

ومن مساوى طريقة الرش الكيميائي الحراري:

- تستعمل مع المواد القابلة للذوبان فقط.
- احتمالية عدم تكون المادة المراد ترسيبها بسبب اختلاف في التفاعل الكيميائي وتكون مادة مختلفة.

(4-1) آلية تكوين الأغشية الرقيقة

(Mechanism of Thin Films Formation)

تتصف البنية التركيبية للأغشية الرقيقة بدرجة كبيرة من التعقيد مقارنةً مع المواد الجاسئة سواء كانت احادية التبلور أو متعددة التبلور، و امتلاكها مناطق عدم انتظام وكثافة وعيوب اكبر بكثير عند موازنتها بالمواد الاخرى وذلك لأنها مواد ذات حجوم حبيبية صغيرة جدا. سلوك خصائص الأغشية الرقيقة (البصرية و الكهربائية والميكانيكية) يتحدد بوساطة التركيب و البنية المجهرية و المركبات الكيميائية و النقاوة والتجانس وهذه العوامل تتأثر بقوة بطرق تحضير الغشاء[10]. وهناك العديد من العوامل التي تحدد الانتظام في الغشاء وبنية البلورية للأغشية الرقيقة بشكل عام، وبشكل خاص فإن التحلل الكيميائي الحراري يضيف عوامل اخرى لها اثر في البنية التركيبية وبداية نمو الغشاء للأغشية المحضرة مثل حجم قطرة وكثافة توزيع قطرات على وحدة المساحة وقطر فتحة جهاز الترذيز. يكون تأثير هذه العوامل مباشراً في تجانس الغشاء وبنيته التركيبية التي بدورها تعكس على الخصائص البصرية والكهربائية[11]. إن الفكرة الاساسية في عملية التحلل الكيميائي الحراري هي توليد رذاذ من قطرات محلول ونقلها بسرعة ابتدائية نحو سطح القاعدة الساخنة[12]. تتبعها الخطوات الأساسية لآلية نمو الأغشية الرقيقة والتي تتمثل

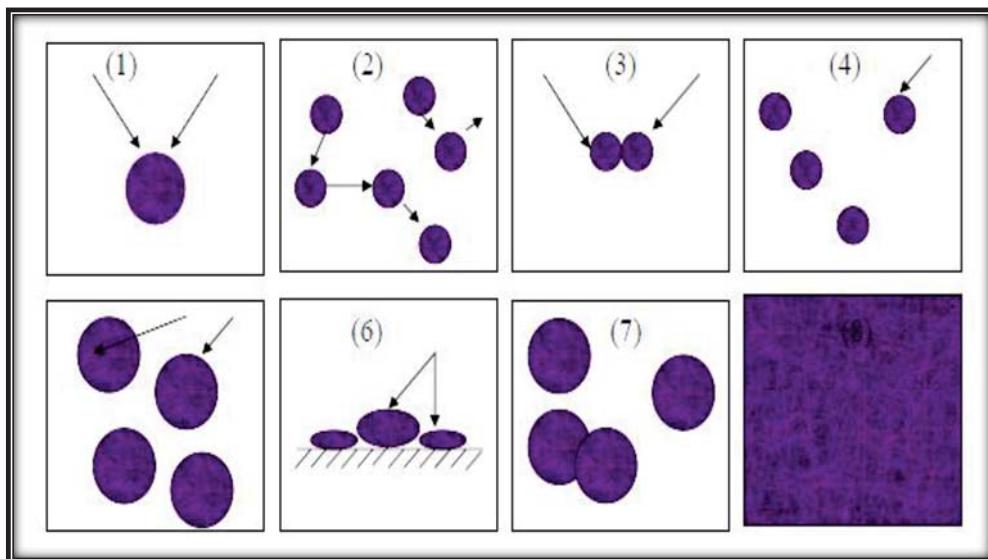
بالاتي:

- حدوث عملية التحلل الكيميائي الحراري للمحلول.
- انماء طبقات المطلوبة للمادة.

تمر عملية إنماء طبقات الأغشية بمراحل اساسية تبدأ بمرحلة التنويم أي تكوين النويات التي تعد الأساس الذي يبني عليه الغشاء الرقيق والتي تكون عند انتقال الذرات او الايونات او الجزيئات من المصدر إلى القاعدة وتتميز النويات الملتتصقة بالقاعدة بحجمها الصغير، ثم تتمو

هذه النويات بالأبعاد الثلاثة وبمحاذاة القاعدة اي ان النمو يكون افقياً اكثر مما هو عمودياً بسبب الانتشار السطحي للذرات وهذه صفة مميزة لنمو الااغشية الرقيقة، بعد ذلك تتصل هذه النويات الواحدة بالأخرى وت تكون الجزر وهذا مرهونا ببعض العوامل المؤثرة منها (معدل الترسيب، درجة حرارة القاعدة ووجود موقع التوبيه على سطح القاعدة)، تليها مرحلة تكوين الحدود الحبيبية الناتجة عن التحام الجزر مع بعضها لتكوين بلورة احادية التبلور فيما اذا كانت الاتجاهات البلورية للجزر الملتحمة باتجاه واحد، فان الجزر سوف تستمر بالالتحام مع بعضها وتبدأ بتغيير شكلها تمتداً و تستطيل مرتبطة مع بعضها مكونة مناطق ضيقة بالقرب من منطقة التصاق بعضها ببعض، و تمتاز هذه المناطق بكونها غير منتظمة و طويلة و تعرف بالقنوات. وفي اثناء استمرار عملية الترسيب تنتج نوى وجزر داخل هذه القنوات و تندمج بسرعة عند ملامسة جدران القنوات مكونة اشباه جسور و تاركة تجاويف داخل الغشاء، تتلاشى هذه القنوات في النهاية مكونة الغشاء نتيجة استمرار تكوين الجزر الثانوية التي تلامس حافات الفجوات و تندمج مع الغشاء. الشكل (2-1)

يوضح المراحل الاساسية في تكوين الااغشية الرقيقة [13].



الشكل (2-1): مراحل تكوين الااغشية الرقيقة [13].

(The Drop Size Effect)

(5-1) تأثير حجم قطرة

تنطلق قطرات بسرعة ابتدائية نحو سطح القاعدة الساخنة ويكون شكل الرش مخروطي ذلك بالاعتماد على المسافة بين فتحة الرش والقاعدة وحجمها كما وضح [14].

ولحجم قطرة تأثير على طبيعة الغشاء المترسب، اذ ان حجم قطرات المتولدة من محلول لا يرتبط بخواص السائل يعتمد فقط على كثافة توزيع قطرات على وحدة المساحة في اثناء عملية الترسيب وأن خصائص الاغشية فضلا عن تأثيرها بحجم قطرات فإنها تتأثر بطبيعة درجة حرارة القاعدة [15].

الحالة A: يكون حجم قطرة كبيراً نسبياً فالحرارة الممتصة من الوسط المحيط تكون غير كافية لتتبخر محلول بالكامل عند رشه باتجاه القاعدة وب مجرد وصول قطرات الى القاعدة الساخنة يتتبخر محلول تاركاً الراسب صلباً، واثناء التبخر يتبدد جزء من الحرارة فتتخفض درجة حرارة القاعدة عند هذه النقطة، مما قد يؤدي الى اجهادات داخلية وبالتالي يكون الغشاء غير متجانس.

الحالة B: في هذه الحالة تجف قطرات قبل وصولها الى سطح القاعدة الساخنة فيحدث تحلل جزئي للمحلول مسبباً تكون رواسب.

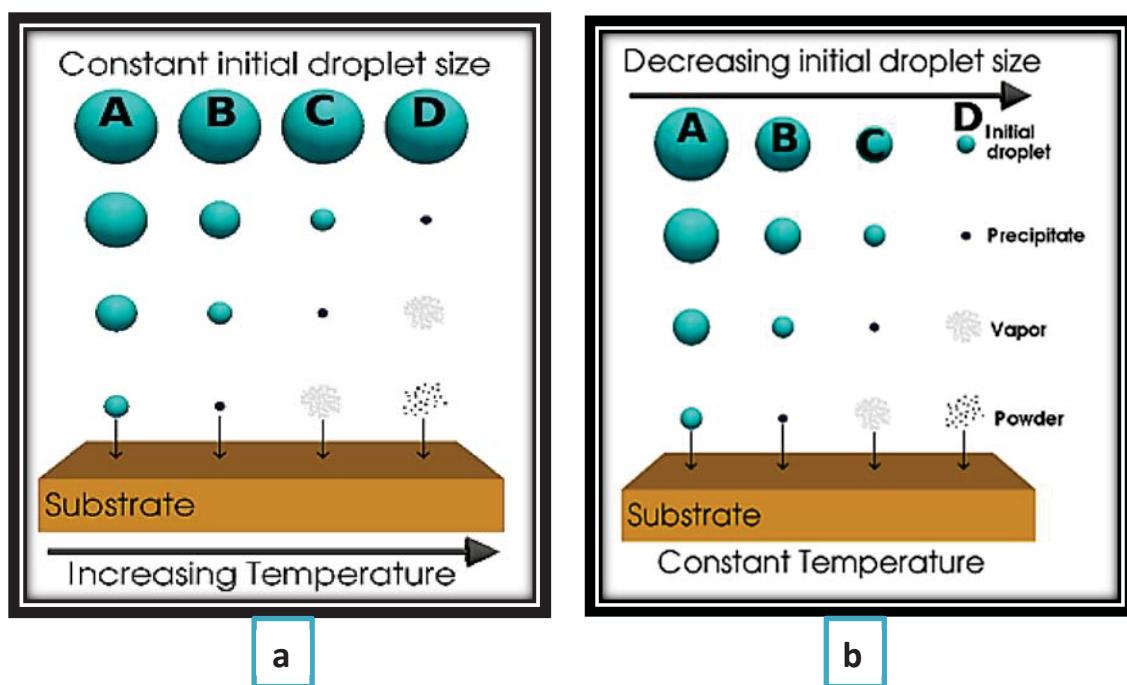
الحالة C: تمثل التحلل الامثل للحصول على غشاء رقيق، في هذه المرحلة يتتبخر محلول عند أقرب نقطة للقاعدة وقبل وصول الدقائق يكون الوقت كافياً لارتفاع درجة الحرارة إلى درجة حرارة الوسط إذ تتبخّر أو تتسامى (Sublimes)، وبذلك يحدث تفاعل يتضمن ما يأتي:

- انتشار الجزيئات المتفاعلة على السطح.

- التصاق جزيئة واحدة أو عدة جزيئات على السطح.

- انتشار سطحي واعادة اتحاد مع الشبكة ومن ثم انتشار الجزيئات الناتجة الى حيز البخار.
- الحالة D: حجم قطرة صغير، فيحدث تبخّر المحلول بصورة كاملة بعيداً عن القاعدة وتتصبّح الدقائق بلورات صغيرة تكون راسبًا اشبه بالمسحوق يعكس الغشاء ويقلل من نفاذية المادة وذلك لأن التفاعل الكيميائي في هذه الحالة يكون اسرع مما عليه في الحالات السابقة. الشكل (3-1) يوضح حالات الترسيب اعتماداً على حجم قطرات المكونة لها [16].

ان الانتقال الأنماذجي لل قطرة نحو القاعدة الساخنة يتم عندما تصل قطرة في اللحظة التي يكون فيها المذيب قد تبخّر بالكامل، ويتبّع ما سبق أن أنساب الظروف لتكوين غشاء بمواصفات جيدة عند حجم قطرة المبين في الحالة C، عملياً لا يمكن تأكيد الظروف الدقيقة لهذه العملية، فضلاً عن حدوث انتقال من التفاعل المتجانس إلى التفاعل غير المتجانس لعدم وجود حجم محدد لل قطرات اذ لابد من السيطرة على عملية الرش للحصول على حجم قطرات المطلوب [17].



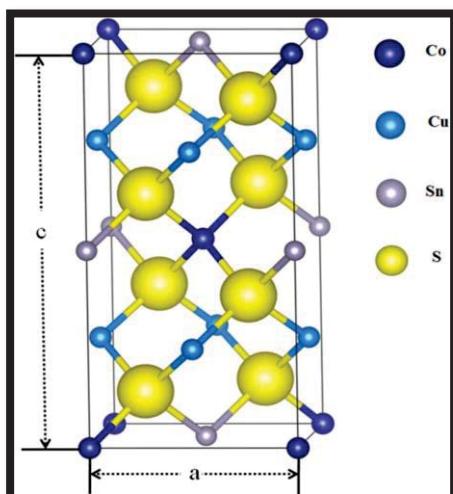
(3-1): تأثير طبيعة الاغشية المترسبة بحجم قطرة و درجة حرارة القاعدة [16].

(a): ثبوت حجم قطرة مع تغير درجة الحرارة (b): حجم قطرة اصغر مقابل ثبات درجة الحرارة

(6-1) تركيب أغشية (Cu₂CoSnS₄) الرقيقة

(Structural of (Cu₂CoSnS₄)Thin films)

يعد CCTS أحد مركبات مجموعة مركبات كالكوجينايد النحاس (Cu-Chalcogenides) الرابعية يتكون من (Co^{IV}=VI=Sn^{II}) وهي عناصر متوفرة وغير سامة. من المعلوم انه يمكن تشويب شبكة (Chalcopyrite) المجموعة الفراغية (d₁₄₂) بذرات من المجموعتين الثانية والخامسة، هذا و يشتق من المركب الثلاثي (CuInS₂) وذلك باستبدال ذرتين من الانديوم بذرة من الكوبالت (Co) وذرة من القصدير (Sn) حسب قاعدة الثمان، وهو مادة متعددة التبلور من طور (Stannite) بتركيب رباعي قائم (tetragonal) بمجموعة مكعبة مغلقة (142m) وابعاد شبكة ([5] a=5.405 Å, c=10.806 Å). تتكون كل خلية وحدة في الشكل الرباعي من ثلات ذرات معدن اذ تحيط بذرة الكبريت ذرة كوبالت واحدة وذرة قصدير واحدة وذرتين من النحاس. يمتلك مركب CCTS فجوة طاقة مباشرة قيمتها (E_g = 1.58 eV) ومعامل امتصاص بصري (~10⁴ cm⁻¹) وتوصيلية موجبة (P-type). شكل (4-1) يوضح وحدة بناء مركب CCTS .[18]



الشكل (4-1): البناء البلوري لمركب CCTS .[18]

(8-1) تطبيقات أغشية CCTS

(Applications of (CCTS) Thin Films)

يعد المركب CCTS أحد مركبات أشباه موصلات Chalcogenides وله تطبيقات عدّة منها [3].

- تستخدم أغشية CCTS الرقيقة كطبقة ماصة (Active layer) في الخلايا الشمسية وخلايا أكسيد الوقود الصلبة والخلايا الشمسية الصبغية، إذ اظهرت كفاءة تحويل للطاقة بقيمة (%) 3.23 [19]. ويمكن استخدام محلول الجزيئي لمركب CCTS السائل كطلاء مباشرةً كطبقة امتصاص في الخلايا الشمسية أيضاً [20].
- تستخدم في المتحسينات وكقطب كهربائي في المكثفات الكهربائية الثلاثية في الخلايا الشمسية الحساسة الصبغية بدلاً من الأل (Platinum) غالٍ الثمن لاختزال ثلاثي اليوديد في الخلايا الشمسية العضوية.
- تدخل في صناعة الكواشف البصرية (Photo detector).

(Literature Review)

(10-1) الدراسات السابقة

- درس الباحث (Cui et al.,2012) الطرق العامة لتحضير شبه الموصل الرياعي إذ ان ($M=Co^{+2},Fe^{+2},Ni^{+2},Mn^{+2}$) وقد أثبت ان تحضير أغشية المركب Cu_2MSnS_4 تتم بنجاح وبسهولة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري، وتبين من نتائج حيود الاشعة السينية ان لديه انماط حيود غير موجودة ولم تذكر في دراسات اخرى ولا في البطاقة القياسية التي ثبت انه من طور (Stannite or Kesterite) مثل مشبك الخارصين كذلك المركبات الاريعية تبدي سلوك مغناطيسي عالي عند درجات حرارية منخفضة. وان فجوة الطاقة بالمدى [21] (1.2-1.5 eV).

■ درس الباحث (Benchikri et al., 2012) عملية تحضير جزيئات كالكوجينياد الرباعية للمركيبين البوتاسيوم $(\text{Cu}_2\text{CoSnS}_4, \text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4)$ من منصهر ثيوسينات (Potassium thiocyanate (KSCN)) عند درجة حرارة مرتفعة (400°C) اذ تسمح الحرارة العالية بتكوين جزيئات Chalcogenides رياعية نقية عالية التبلور، وقد بين الباحث أن السيطرة على حجم البلورات الاولية يتم عن طريق تغيير التجانس الكيميائي للمواد الاولية للتحضير، وأنه يمكن استخدام هذه الطريقة لتحضير طبقات ماصة في الخلايا الشمسية منخفضة التكلفة. تظهر اطيف رaman المسجلة لأغشية CCTS اختلاف طفيف في تردد القمة الرئيسي المحدد عند 326 cm^{-1} يصاحبه ظهور قمة ثانوية عند 286 cm^{-1} و 359 cm^{-1} والقمة (305 cm^{-1}) بعرض منتصف قمة كبير غير المبرر لأغشية $(\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4)$. [22]

■ حضر الباحث (Zhang et al., 2013) بلورات نانوية احادية لأغشية $(\text{Cu}_2\text{CoSnS}_4)$ بطوريين (Wurtzite and Stannite) بزيادة تأثير درجة الحرارة او عن طريق عملية التلدين بدرجات حرارية عالية، اذ نمت البلورات النانوية (CCTS-Wurtzite) على شكل قضبان نانوية وكانت قيمة فجوة الطاقة لهذه الاغشية (1.58 eV) ولأغشية-CCTS المحضرة عند درجة حرارة (310°C) كانت بقيمة (1.41 eV) و أنه بزيادة درجة حرارة التفاعل من 190°C الى 310°C يتغير الهيكل البلوري من طور (wurtzite) نقي لطور (Stannite) ويتطابق نمط (XRD) بشكل جيد مع نمط (XRD) القياسي لطور (Stannite) في البطاقة رقم (ICDD:26-0513). وظهور القمم الضعيفة حول $(23.27^{\circ}, 37.18^{\circ}, 38.17^{\circ})$ يؤكد أن المركب يتبلور بطور (Stannite). [23]

عمل الباحث (Murali et al., 2014) على تحضير محلول مركب (CCTS) بطريقة (Sol-gel) وترسيبه على قواعد زجاجية بطريقة (Spin coating)، اذ درس الطور المطلوب تشكله من خلال دراسة تأثير تغير درجة حرارة التلدين على الاغشية المحضرة اذ يتحول الغشاء من التركيب العشوائي الى متعدد التبلور بطور (stannite) بتأثير التلدين، إذ تم معرفة ذلك من خلال اجراء الفحوصات الترکیبیة لھیود الاشعنة السینیة وقد وضح الباحث سبب استخدامه طريقة (Sol-gel) لأنھ یفضل ان تكون الاغشیة الرقيقة ذات معدل خشونة منخفض التکوین وبسطح ناعم [2].

استطاع الباحث (Shi et al., 2014) تحضير اغشية المركب الرباعي $\text{Cu}_2\text{CoSnS}_4$ احادية التبلور نانوية التركيب بطريقة الترسیب من المحاليل Solvothermal واستخدم diethylenetriamine كمذیب، ووجد الباحث أن (112) هو اتجاه النمو السائد وكشفت فحوصات طيف الامتصاص للأشعة UV-Vis ان الاغشیة المحضرة ذات معامل امتصاص عالي وفجوة طاقة بقيمة (1.5 eV) كما أظهرت هذه الاغشیة توصیلية معززة تحت الاشعة المرئية مما يجعلها ملائمة للتطبيقات الضوئية وقد تكون واعدة للاستخدام كطبقات امتصاص للضوء في الخلايا الشمسية كما ان الاسلاك النانوية لأشباه موصلات Chalcopyrite، ظهرت قم طيف رaman بأعلى شدة عند 320 cm^{-1} وان اشاره رaman القريبة من القمة 300 cm^{-1} تعود للتناظر التام لذرات الكبريت مع اختلاف بسيط .[24]

رسب الباحث (Gupta et al., 2015) اغشية $\text{Cu}_2\text{CoSnS}_4$ بطور Wurtzite بنجاح باستخدام طريقة الحقن الحراري (hot-injection) وقد استخدم عنصر الكبريت كمصدر للكبريت. و درس الباحث الخصائص الترکیبیة والھیكلیة لأغشیة CCTS باستخدام فحص

حيود الاشعة السينية (XRD) اذ تظهر انماط حيود الاشعة السينية عند (100) (2θ~29.73°,31.92°,49.41°,53.32°,58.16°) التي تقابل كل من المستويات (112), (103), (101),(110), (002), الغشاء تقع ضمن المواد شبه الموصلة من خلال القياسات البصرية أيضا كانت قيمة مقاومة الاغشية تساوي (0.8 Ω.cm).[25]

- تمكن الباحث (Zhong et al., 2015) من تحضير اغشية CCTS عند درجة حرارة 200°C ولمدة 12 ساعة بطريقة (Solvothermal)، حيث استعمل (Cysteine) كمصدر للكبريت وعامل مساعد في تكوين $\text{Cu}_2\text{CoSnS}_4$ من خلال دراسة حيود الاشعة السينية فقد ظهرت انماط الحيود عند (2θ~28.6°,33.1°,47.6°,56.5°,69.6°,76.9°) المقابلة للمستويات (204) (312) و (400),(112) على التوالي بتركيب رباعي قائم بطور (Stannite) ولا وجود لأنماط حيود لأطوار ثانوية تابعة لمركبات ثنائية او ثلاثة مثل ($\text{Cu}_2\text{S},\text{SnS}_2,\text{CoS},\text{Cu}_3\text{SnS}_4$) وبإجراء تحليل طيف رaman للأغشية ظهرت اربعة قمم عند (287,321,344,355 cm⁻¹)، وقد اكد الباحث ان هذه القمم تتافق مع الاهتزاز الكلي المتماثل لذرات الكبريت في مركبات كالكوجينيايد النحاس الرباعية اي ان هذه القمم من الممكن ان تعزى للأغشية [26].

- تمكن الباحث (Krishnaiah et al., 2015) من تحضير أغشية CCTS من محاليل المعادن بوساطة عملية الترسيب بالبخار (Thermal decomposition) وSpin Coating) على قواعد من زجاج (SLG,FTO) باختلاف تأثير درجة الحرارة والזמן، ودراسة خصائصها التركيبية والبصرية والكهربائية لاستخدامها في التطبيقات

الفولتاوصوئية. و بينت نتائج حيود الاشعة السينية أن الأغشية المتكونة بطور Stannite

بحجم حبيبي (8,10,13,15,18nm) المقابلة للأغشية المحضرة بالمدى

(250,300,350,400,450 °C) ولمدة ساعة على التوالى واكد تحليل طيف رaman الطور

النقي للأغشية عند القمة cm^{-1} 325 مع وجود قمم لأطوار ثانوية cm^{-1} 281 الناتجة من

اهتزاز ذرات أيونات الكبريت والكوبالت والقمة cm^{-1} 364 الناتجة من اهتزاز ذرت الفصدير

و الكبريت المشتركة مع ذرات النحاس في مركب CCTS و القمة cm^{-1} 321 لمركب

CFTS ووجد من فحوصات (UV-visible) ان أغشية CCTS تمتلك فجوة طاقة مثالية

بقيمة (1.46 eV) واكدت الفحوصات الكهربائية ان أغشية CCTS من النوع الموجب

(P-type) وكشفت عن قيم كل من التحركيه وتركيز حاملات الشحنة و المقاومية بالقيم

ال التاليه ($cm^2v^{-1}s^{-1}$) $[2\times 10^{-3} \Omega.cm]$ و ($\mu=11.5$) و ($n=5.2\times 10^{16} cm^{-3}$). [4]

▪ نجح الباحث (Ozel, 2016) في تحضير أغشية مركبات شبه الموصل الرباعي

(Cu_2FeSnS_4 ، Cu_2CoSnS_4 ، Cu_2NiSnS_4 ، Cu_2MnSnS_4) بتقنية

(Electrospinning)، إذ تبين من نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (XRD) و

القياسات البصرية (SEM) و (UV-visible) أن الأغشية المحضرة ذات تراكيب نانوية

(Nano fiber) من نوع رباعي قائم و لها توصيلية موجبة (P-type) و تمتلك معامل

امتصاص عالي مما يجعلها مواد واعدة لتطبيقات الطاقة البديلة[27].

▪ عمل الباحث (Ghosh et al., 2016) على تحضير أغشية مركبات كبريتيد النحاس

الرباعية ($Cu_2-II-Sn-S_4$) (II=Fe,Co,Ni) على قواعد من زجاج (ITO) بطريقة

(Spin Coating) واتضح ان شكل السطح الخارجي للأغشية عبارة عن بنية مسامية

متماطلة بمتوسط سمك للأغشية (1.5mm) كذلك كشف تحليل طيف رaman عن ظهور القمم

الرئيسية عند (cm^{-1}) (331.58) [CFTS]

و(325cm^{-1}) و(330.63cm^{-1}) ل(CNTS) نتيجة الحركة الاهتزازية لذرات

الكربون وقد وجد ان قيم فجوة الطاقة هي (1.87eV,1.57eV,1.74eV) للأغشية

(CFTS,CCTS,CNTS). جميع نماذج الأغشية الرقيقة المحضرة تتطابق تماماً مع بطاقة

CZTS(JCPDS 26-0575) ولا وجود لطور ثانوي مثل CuS عند درجة حرارة منخفضة

.[28]

▪ استطاع الباحث (Mokurala et al., 2016) تحضير أغشية (CCTS,CFTS) من

الرقية كمواد نشطة كهربائياً من محليل المواد اذ تمت اضافة النسب (2:1:1:4) من

أثيلين كلايكول (EG) وتخلط بواسطة (Cu:Fe/Co:Sn:S)

الخلاط لمدة 30 min ليتجانس المحلول. أنماط حيود الاشعة السينية تتطابق مع البطاقة

القياسية ذات الرقم (26-0513) للأغشية CCTS بطور Stannite وكان معدل الحجم

البلوري المحسوب يساوي (10nm) باستخدام معادلة (Scherrer)، كما أظهرت نتائج قياس

تأثير هول أن الأغشية المحضرة من نوع (P-type)، وكانت قيم كل من التحركيه وتركيز

الحملات و المقاومية تساوي ($n=5.2\times10^{16}\text{ cm}^{-1}$) و ($\mu=11.5\text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$) و

[29].
▪ حضر الباحث (Bakr et al., 2016) أغشية CZTS المترببة بطريقة التحلل الكيميائي

الحراري عند درجة حرارة قاعدة (400 °C) ذات سمك يتراوح بين (300-350 nm) حيث

درس الباحث تأثير تغير تركيز الثايريا، اظهرت نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية ان

الأغشية المحضرة ذات تركيب متعدد التبلور من النوع الرباعي ذو الطور السائد (112)

حيث تم حساب الحجم البلوري باستخدام معادلة شرر ووجد ان أغشية CZTS المحضرة عند

تركيز (M) من الثايريا تمتلك اكبر قيمة للحجم البلوري بقيمة (31.25 nm) و اقل

قيمة للحجم البلوري كانت (18.02 nm) عندما كان تركيز الثايريا (0.16 M) [30].

قام الباحث (Liu et al., 2017) بتصنيع أغشية (Cu₂MSnS₄(M=Co⁺²,Ni⁺²)

الرقيقة بتركيب نانوي واستخدامها في تطبيقات الكواشف البصرية ووضح الباحث انه يمكن

اعتبار (CCTS,CNTS) كمركيبات Cu₂ZnSnS₄ اذ يمكن استبدال أيون Zn⁺² بأيون

Co⁺² أو ايون Ni⁺² باستخدام تقنية الاستبدال الأيوني من خلال عملية فصل التفاعل

المؤكسد لأيونات (Ni⁺²,Co⁺²) مع بخار السلينيوم بدرجة حرارة عالية. ظهرت انماط حيود

الأشعة السينية ل (CCTS) عند (2θ~28.6°,48.0°,56.7°) والتي تقابل المستويات

(311) و(220) و(111) بالمقارنة مع البطاقة القياسية (26-0513) وقد كانت قيمة فجوة

الطاقة تساوي (1.40 ev,1.35 ev) لأغشية CNTS,CCTS على التوالي [15].

حضر الباحث (Maldar et al., 2017b) CCTS الرقيقة من كلوريدات المعادن

مع الكمية المكافئة لها من الثايريا، وقد حضر محلول المواد من اذابتها في كحول الميثanol

حيث تم ترسيبها على قواعد زجاجية (SLG) بطريقة التحلل الكيميائي الحراري وبدرجة

حرارة قاعدة مختلفة (275,325,375 °C). درس الباحث الخصائص التركيبية والبصرية

للأغشية المحضرة، إذ اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية ان الأغشية ذات تركيب متعدد

التبلور من الطور (Stannite) و بالوجه السائد (112) ذو شكل رباعي قائم، كذلك تم

تحديد الطور النقي لأغشية CCTS من تحليل طيف رaman للأغشية المرسبة عند درجة

حرارة (325°C) بالمدى (320 cm⁻¹-450 cm⁻¹) ، إذ ظهرت اعلى شدة عند (320 cm⁻¹)

كما بين الباحث ان غياب القمة عند (350 cm⁻¹) يشير إلى عدم تكون اطوار ثانوية مثل

(SnS₂,CuCoS₂) في أغشية CCTS، وأوضحت نتائج الفحوصات البصرية ان قيمة

فجوة الطاقة تقل من (1.7 eV) إلى (1.4 eV) بزيادة درجة حرارة القاعدة من (275 °C) إلى (325 °C). وفي العام نفسه حضر الباحث اغشية CCTS على قواعد (SLG,FTO) باختلاف تأثير درجة حرارة القاعدة المستخدمة للترسيب بالمدى (250-300-350-400 °C) بطريقة التحلل الكيميائي الحراري وقد بين الباحث أن سمك الاغشية يقل بزيادة درجة الحرارة وان التحلل يحدث قبل وصول القطرات الى القاعدة الساخنة عند درجة حرارة 400 °C كذلك عرض فحص FE-SEM صوراً لاغشية CCTS المحضرة في درجات حرارة مختلفة فقد اظهر أنَّ الاغشية المحضرة في درجة حرارة 250°C ذات تضاريس غير متناسقة كما ان توافر مراكز التتوبي في بعض المناطق ادى الى فرط نمو جسيمات CCTS على سطح الغشاء وهذا يعزى الى التكتل المكون لمجاميع من جسيمات CCTS، أما الاغشية المحضرة عند درجة حرارة 300°C فإنها ذات توزيع غير منتظم للحبوب غير المتساوية مع ملاحظة وجود بعض الفراغات على سطح الغشاء كما تم العثور على تضاريس غير منتشرة على كل مناطق سطح الغشاء. تختلف الاغشية المحضرة عند درجة حرارة 350°C في تضاريسها إذ تبدو اكثر هيمنة وتظهر على سطح هذه الاغشية سلسلة من الرقائق كثافة هذه الرقائق ليست نفسها على كامل السطح ويبدو سطح الغشاء اكثراً احكاماً مع وجود بعض الفراغات [6].

- حضر الباحث (Diwate et al., 2017) اغشية CZTS باستعمال تقنية التحلل الكيميائي الحراري (CSP) بتراكيز مولارية مختلفة من مصدر الكبريت، كانت الاغشية المحضرة متعددة التبلور ذات تركيب (kestrite) الرباعي القائم وبالاتجاه السائد (112)، وان معدل الحجم البلوري المحسوب بطريقة شر (Scherrer method) يقل بزيادة تراكيز الكبريت كما لاحظ الباحث ان سمك الاغشية يقل من (392 nm-505) بزيادة تراكيز الكبريت من

(0.12-0.16 M) عند زيادة تركيز الكبريت إلى (M 0.18) يزداد السمك إلى

(439 nm) وهذا يشير إلى أن عملية نمو أغشية (CZTS) تجري عبر عمليات التوسيع

والنمو المعقّدة المختلفة التي تحدث في وقت واحد على القاعدة، كما أظهرت مطيافية رaman

قمة منفردة عند (cm^{-1} 332) وبينت القياسات الكهربائية توصيلية من النوع الموجب

P-type تعود لحاملات الشحنة الأغلبية (الفجوات)[32].

■ قام الباحثان (Ghediya and Chaudhuri, 2018) بترسيب أغشية CCTS الرقيقة من

المحلول الجزيئي باستخدام تقنية (dip-Coating) يتكون محلول الجزيئي من معدن

(الثايريا + المعادن) المذابة في الميثانول ، إذ يتم تجفيف الأغشية بدرجة حرارة $^{\circ}C$ 200

لمندة min 20. و أظهرت نتائج فحوصات حيود الأشعة السينية وتحليل طيف رaman

طور Stannite النقي لأغشية CCTS إذ ظهرت قمة الحيود عند

(204) $2\Theta \sim 28.65^{\circ}, 47.58^{\circ}, 56.40^{\circ}$ التي تميز الحيود عند المستويات (112) و(312)

و(312) على التوالي لمركب CCTS بالمقارنة مع البطاقة القياسية (ICDD) ذات الرقم

Scherrer التسلسلي (0513-26) وكان الحجم البلوري المحسوب باستخدام معادلة شيرر

تقريبا (5nm)، وظهرت قمة رaman عند cm^{-1} 322 فقط كطور منفرد كما وبينت الفحوصات

البصرية (UV-visible) ان النفاذية تكون عالية من (1300-1500nm) وتقل عند

1100nm فما دون، ووجد أن قيمة فجوة الطاقة للأغشية تساوي (1.2 eV) ولمحلول

الطلاء (1.3 eV). كشفت القياسات الكهربائية عن قيمة التوصيلية الكهربائية تساوي

.[20] ($S.cm^{-1}$ 0.07)

- عمل الباحثان CCTS (Sharma and Thangavel, 2018) على تحضير أغشية على الرقيقة من المحاليل بطريقة (Spin Coating) ثم ترسيبها بتقنية (Sol-gel)، وقد اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية انماط الحيود عند ($2\Theta \sim 28.6^\circ$) التي تقابل المستوى (112) والتي تؤكد ان المركب ذو تركيب رباعي قائم وبطور (Stannite)، كما وبيّنت صور (UV-Visible) ان الاغشية ذات سطح متجانس ومنظم. عن طريق فحص (FE-SEM) تم حساب قيمة فجوة الطاقة ووجد انها تساوي (1.45 eV) وهي مناسبة تماما للاستخدام في تطبيقات الخلايا الشمسية، وأكد قياس تأثير هول ان أغشية CCTS من النوع الموجب (P-type) و بمقاومة تقربيا ($\sim 0.04 \Omega \cdot \text{cm}$) وتحركية للحاملات تقربيا ($4.665 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$). [33]
- حضر الباحث Wang et al. 2018 أغشية المركب $\text{Cu}_2\text{CoSnS}_4$ بنجاح بطريقة الترذيز بالتردد الراديوي المغناطيسي (RF) بتأثير اختلاف ترتيب تسلسل الطبقات المترسبة (Cu/Sn/Co,Cu/Co/Sn) و درجة حرارة القاعدة على الخصائص التركيبية والبصرية. وبيّنت نتائج فحص حيود الاشعة السينية (XRD) وتحليل طيف رaman ان الاغشية التي تحضيرها ذات تركيب رباعي بطور Stannite، وان نوعية التبلور وهيكليّة التركيب قد تحسنت مع ارتفاع درجة الحرارة، إذ أن أفضل غشاء تم الحصول عليه كان بدرجة حرارة (600 °C) للترتيب (Cu/Co/Sn) الذي يمتلك فجوة طاقة بقيمة (1.58 eV).

(The Aim of The Work)**(10-1) الهدف من البحث**

تهدف الدراسة الحالية الى تحضير اغشية CCTS الرقيقة على قواعد زجاجية وبدرجة حرارة قاعدة (400 °C) بطريقة التحلل الكيميائي الحراري للحصول على اغشية بمواصفات جيدة من تجانس عالي وقوة التصاق بالقاعدة وبسمك تقريبي (350 nm) ، ودراسة تأثير تركيز الكبريت على بعض خصائصها التركيبية والبصرية و الكهربائية، وذلك لغرض الحصول على اغشية ذات مواصفات فيزيائية جيدة يمكن استخدامها في تطبيقات الخلايا الشمسية والكهرو بصرية.